# 科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 28 年 6 月 9 日現在

機関番号: 15201 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2013~2015

課題番号: 25870448

研究課題名(和文)Zn0系ナノ粒子を用いた塗布型トランジスタ実現のための基礎的検討

研究課題名(英文)Basic investigation aiming for realization of thin film transistors using sprayed ZnO nano-particle layers

研究代表者

吉田 俊幸 (Yoshida, Toshiyuki)

島根大学・総合理工学研究科(研究院)・助教

研究者番号:50335551

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,300,000円

研究成果の概要(和文):ガス中蒸発法で作製したZnOナノ粒子をガラス基板上に塗布し,n型およびp型のZnO薄膜の形成に成功した。またこの塗布膜のみを用いてpn接合ダイオードや,n-チャネルおよびp-チャネル薄膜トランジスタ(TFT)を作製した。これは世界で初めての試みである。これにより,従来の集積回路技術を活かしたまま,より幅広い基板材料や表面形状など,粒子層が形成可能なあらゆる場所へ電子回路を作り込めることを示した。また今回用いた粒子層の形成法は,滴下法,スプレー法,沈殿堆積乾燥法である。これらは設備投資や製造コストが極めて低い手法であり,全国に多数ある中小企業も参画できる技術である。

研究成果の概要(英文): The n-type and the p-type ZnO layers were successfully obtained using ZnO nano-particles (NPs) synthesized using the arc-discharge-mediated gas evaporation. And, we achieved the world's first pn diodes and p-channel and n-channel thin film transistors (TFTs) using only ZnO NPs. By using these techniques, it was shown that the integrated circuits (ICs) with the conventional gate logic rules can be formed on the various kinds of substrates; i.e. the various materials and/or surface morphologies. In this study, the drop casting, the spraying and the liquid-phase precipitation deposition methods were tried. These methods have a possibility to achieve the extremely low capital investment and low process cost, which can make many small and medium-sized enterprises participating in this field.

研究分野: 半導体デバイス

キーワード: ZnOナノ粒子 塗布法 p型伝導 TFT

#### 1.研究開始当初の背景

- (2) ZnO 系半導体材料の分野では,プロセス上,酸素欠損によりn型化してしまい,p型伝導層を得ることが難しいという問題がある。当研究グループが開発した ZnO ナノ粒子を用いることでp型伝導層を得られることを示すことは,学術的にも,また今後のデバイス応用にも,極めて重要な成果となる。

## 2. 研究の目的

- (1) 当研究室で開発したガス中蒸発法を用いた窒素ドープ ZnOナノ粒子の生成において, 生成条件と窒素濃度の関係を調べ,窒素濃度 と,粒子層化した際の伝導特性(伝導型,キャリア濃度,移動度など)との相関を調べる。
- (2) ZnOナノ粒子を用いた pn 接合構造の形成とその特性評価を行う。
- (3) ZnO ナノ粒子をチャネルとする n 型および p 型の薄膜トランジスタ (TFT) を試作する。

#### 3.研究の方法

- (1) ZnO ナノ粒子は当研究グループで開発したガス中蒸発法により生成する。チャンバー内の圧力やアーク電流を制御することで粒子中の窒素濃度を制御できる。ここでは窒素ドープ量を高める条件と,窒素ドープを極力抑える条件の2種類を選んだ。
- (2) 粒子層の形成には、ZnO ナノ粒子の分散液(粒径 200-300 nm)を作製し、滴下法、スプレー法、沈殿堆積乾燥法の3つの方法により、ガラス基板上へZnOナノ粒子層を形成した。滴下法では、マイクロピペットを用いて5 ul の分散液を数 10~100 回、加熱した(500)ガラス基板上へ滴下することで、~数 um の粒子層を形成した。スプレー法では、一般的な工芸用のエアブラシにより、30 ml の分散液を500回に分けて噴霧し約20 um

- の粒子層を得た。ガラス基板の温度は,p型 伝導を目指す高窒素ドープ粒子層では 250 n型伝導を目指す粒子層では 500 とした。 一方,沈殿堆積乾燥法では,大気中または減 圧環境下で分散液中にガラス基板を浸漬し, 自然乾燥により粒子層を形成した。
- (3) 構造評価には光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡(SEM),光学特性評価にはフォトルミネッセンス(PL)測定,化学的組成評価にはX線光電子分光(XPS)測定(@北海道大学),表面ポテンシャル評価にはケルビンプローブ(KFM)測定,窒素原子濃度評価には熱伝導度検出法(TCD,@島根県産業技術センター),移動度の評価にはホール効果測定を行った。以上,注釈のない装置および評価法は島根大学の施設を利用した。

## 4. 研究成果

- (1) SEM 観察により,滴下法,スプレー法, 沈殿堆積乾燥法を用いることで,ガラス基板 上へ ZnO ナノ粒子層が形成されたことを確認 した。
- (2) 滴下法により形成した n-Zn0 ナノ粒子層 に熱プレス(300 ,900kg/cm<sup>2</sup>)を施すこと で 粒子層のシート抵抗は 1012 Ω台から 108 Ω 台にまで低減することができ,また移動度は 0.2 cm<sup>2</sup>/Vs から 3.7 cm<sup>2</sup>/Vs まで増加させるこ とができた。XPS 測定, KFM 測定, PL 測定な どによる評価結果から,熱プレスにより粒子 層表面近傍の表面ポテンシャルが低減する ことや,各粒子表面の欠陥が減少すること (粒子表面の 0H 基の酸素原子が 0 空孔を補 償したと考えている)を確認した。これらの 粒子層をチャネルとする TFT を試作したとこ ろ,熱プレス前の粒子層では極めて貧弱なト ランジスタ特性しか得られなかったが,熱プ レスを行った粒子層では,ドレイン電流に明 確なゲート制御性が現れ, 大幅な改善が確認 できた。しかし,トランジスタとしての性能 はまだ低い結果となった。
- (3) スプレー法により形成した ZnO ナノ粒子層では,SEM 観察より,滴下法と比べ下下大式的密な膜が出来ることが分かった。滴が一大性較的密な膜が出来ることを繰り返すため,膜を発することを繰り返すため,膜は変化が基板でで、表現して ZnO ナノとでは見られなかった。しかし抵抗ではを変化は見られなかった。した膜に匹敵が表現したが,スプレー法では表面で流過では見られなかった。したした膜にで高いるでは見られる。より間便で記述が著な変化は見られる。より間便で記述が著な変化は見られることが分かった。

(4) ガス中蒸発法において,粒子中の窒素濃 度が高い条件と低い条件でそれぞれ ZnO ナノ 粒子を作製し,スプレー法によりガラス基板 上に塗布することで, それぞれ p 型と n 型の 伝導特性を示す Zn0 ナノ粒子層を,再現性良 く形成できることを示した。ホール効果測定 より,移動度とキャリア濃度はそれぞれ,p 型粒子層ではおよそ 5.0 ~ 7.0 cm<sup>2</sup>/Vs. 2.0x10<sup>12</sup> cm<sup>-3</sup>, n 型粒子層ではおよそ 0.18~  $0.74 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ ,  $7.0 \times 10^{15} \sim 5.5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  となっ た。また,ガス中蒸発法の条件を変化させる ことで,得られる Zn0 ナノ粒子中の窒素濃度 を変えたところ,窒素濃度とキャリア濃度に は相応の相関があることを確認した。これよ リ, 当研究室で作製された Zn0 ナノ粒子には 確かに窒素原子がドープされており、またア クセプターとして機能していることを確認 した。

(6) スプレー法により,n型粒子層上にp型粒子層を形成し,Zn0ナノ粒子のみでpn接合ダイオードを試作し,整流性を確認した。オールナノ粒子の Zn0でpn接合の動作を確認したのは世界で初めてのことである。しかし,リーク電流が大きいことや,順方向電流の立ち上がり電圧が小さいことなど,解明すべき点は残っている。

 $(7) \, \text{Si}/\text{Si}\, 0_2$ 基板上に p型または n型 ZnO ナノ粒子層を形成し、さらにソース / ドレイン電極を形成することにより、バックゲート・デプレーション型の TFT を試作した。いずれも明瞭なゲート制御性を示し、さらにゲート電圧の極性より、キャリアの担い手が p型粒子層を用いた TFT ではホール、n型粒子層を用いた TFT では電子であることを確認した。ZnOナノ粒子をチャネルに用いた TFT で、n-チャネル型および p-チャネル型のトランジスタを作り分けた例は世界で初めての試みであり、大変注目すべき結果である。

(8) 沈殿蒸発乾燥法による ZnO ナノ粒子層の 形成も試みた。現段階では詳細な検証が進ん でいないが,滴下法やスプレー法を凌ぐ電気 的特性を持つ ZnO ナノ粒子層を得られる可能 性が示唆された。例えば SEM 観察からはより 緻密な粒子層が得られることや,シート抵抗 で数桁の低抵抗化が達成できる可能性を見 出した。

## 5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

## 〔雑誌論文〕(計1件)

<u>Toshiyuki Yoshida</u>, Kazato Shinohara, Daiki Itohara, and Yasuhisa Fujita, "Effects of thermal pressing on ZnO nanoparticle layers deposited by drop casting", e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, **14** (2016) pp.175-178, 查読有.

#### [学会発表](計10件)

Daiki Itohara, <u>Toshiyuki Yoshida</u>, Yasuhisa Fujita, "Realization of thin-film-transistors with channel regions formed by sprayed n-type and p-type ZnO nano particle layers", 28<sup>th</sup> International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2015), Toyama International Conference Center (Toyama), Japan, Nov.10-13 (2015)

糸原大貴,篠原風人,<u>吉田俊幸</u>,藤田恭久,「塗布法による酸化亜鉛ナノ粒子層 pn 接合の作製と評価」,第62回応用物理学会春季学術講演会,東海大学 湘南キャンパス(神奈川)2015/3/11-14.

篠原風人,糸原大貴,<u>吉田俊幸</u>,藤田恭久,滴下法により形成した ZnO ナノ粒子層の MES-FET 応用のための基礎的検討」,第 62 回応用物理学会春季学術講演会,東海大学 湘南キャンパス(神奈川)2015/3/11-14.

糸原大貴,篠原風人,<u>吉田俊幸</u>,藤田恭久,「エアブラシを用いた塗布法により作製した酸化亜鉛ナノ粒子層の電気伝導特性の評価」,第16回IEEE 広島支部学生シンポジウム,広島市立大学(広島)2014/11/15-16.

糸原大貴,篠原風人,<u>吉田俊幸</u>,藤田恭久,「エアブラシを用いた塗布法によるn型およびp型酸化亜鉛ナノ粒子層の作製と評価」,第75回応用物理学会秋季学術講演会,北海道大学(札幌)2014/9/17-20

篠原風人,糸原大貴,<u>吉田俊幸</u>,藤田 恭久,「ZnOナノ粒子を用いたトランジ スタ作製技術の基礎研究」,2014年度応 用物理学会中国四国支部 若手半導体 研究会,レインボープラザ(松江) 2014/7/27

篠原風人, 糸原大貴, <u>吉田俊幸</u>, 藤田 恭久,「薄膜トランジスタ応用を目指し た n 型酸化亜鉛ナノ粒子層の作製と評価」, 2014 年度応用物理・物理系学会中 四国支部合同学術講演会, 島根大学( 松 江 ) 2014/7/26

糸原大貴,篠原風人,吉田俊幸,藤田

恭久,「エアーブラシを用いた吹付け法による酸化亜鉛粒子層の作製と評価」, 2014年度応用物理・物理系学会中四国 支部合同学術講演会,島根大学(松江) 2014/7/26

篠原風人,糸原大貴,<u>吉田俊幸</u>,藤田恭久,「滴下法により形成した酸化亜鉛ナノ粒子層の電気的特性評価」,第 61 回応用物理学会春季学術講演会,青山学院大学 相模原キャンパス(神奈川)2014/3/17-20.

篠原風人,糸原大貴,<u>吉田俊幸</u>,藤田恭久,「塗布法による酸化亜鉛ナノ粒子層の作製」,第 15 回 IEEE 広島支部学生シンポジウム,鳥取大学(鳥取)2013/11/16-17.

## 6.研究組織

## (1)研究代表者

吉田 俊幸 (YOSHIDA, Toshiyuki) 島根大学・大学院総合理工学研究科・助教 研究者番号:50335551

- (2)研究分担者
- (3)連携研究者

## (4) 研究協力者

藤田 恭久(FUJITA Yasuhisa) 篠原 風人(SHINOHARA Kazato) 糸原 大貴(ITOHARA Daiki)